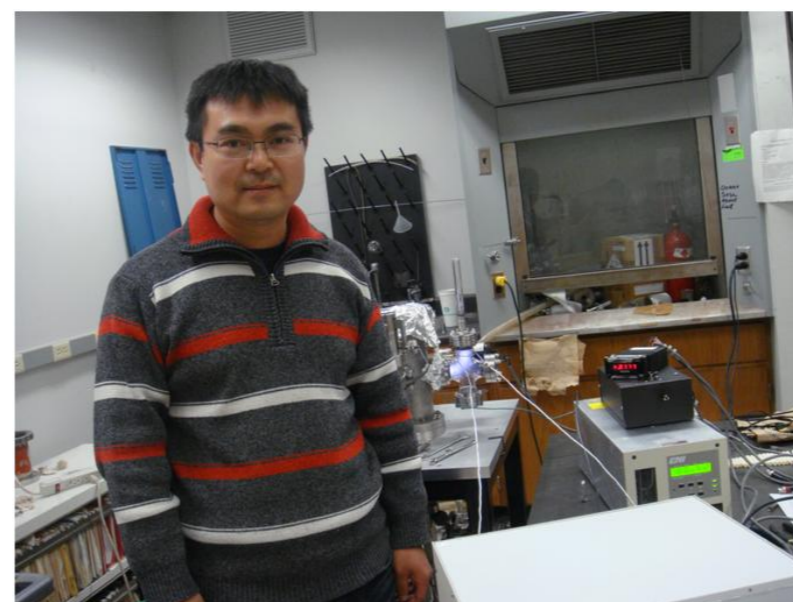


王庆

发布时间: 2015-11-05 浏览次数: 1390



王庆 (1970-), 男, 工学博士, 博士后出站人员, 东北大学副教授, 硕士生导师, 美国University of North Texas大学访问学者。联系方式: 13940400630 (手机), qingwang@mail.neu.edu.cn (邮件);

主要研究方向是:

- (1) 纳米薄膜的物理化学气相沉积;
- (2) 机械零件的等离子体表面改性;
- (3) 纳米薄膜的机械学性能研究。

讲授本科生课程—《过程装备控制》(课堂教学、实验); 曾经获得2008冶金部科技进步3等奖, 沈阳市科技进步3等奖各一项。

近期论文:

- [1] Wang Qing, Ba Dechun. The effect ions current density on target etching in Radio Frequency-Magnetron Sputtering Process. Plasma Science and Technology, 2012, 14
- [2] Swayambhu Behera, Qing Wang. The plasma pretreatment effects on oxygen plasma-induced carbon loss and surface roughening in an ultralow-k organosilicate glass film. J. Phys. D: Appl. Phys. 44 (2011) 155204

[3] Qing Wang, De-chun Ba. An investigation on hysteresis process of ZnO film deposition and changes of surface morphology and wettability Materials Letters 68 (2012) 320–323

(责任编辑: admin)

校址: 辽宁省沈阳市和平区文化路三巷11号 | 邮编: 110819 | 辽ICP备11009868号-3
Northeastern University 2015